



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109494311 A

(43)申请公布日 2019.03.19

(21)申请号 201811367369.0

(22)申请日 2018.11.16

(71)申请人 京东方科技集团股份有限公司
地址 100015 北京市朝阳区酒仙桥路10号

(72)发明人 罗程远

(74)专利代理机构 北京中博世达专利商标代理
有限公司 11274

代理人 张静尧

(51)Int.Cl.

H01L 51/52(2006.01)

H01L 51/56(2006.01)

H01L 27/32(2006.01)

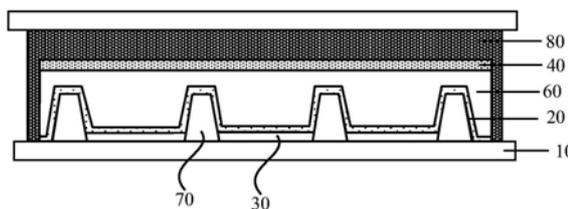
权利要求书2页 说明书6页 附图2页

(54)发明名称

基板及其制备方法、显示面板

(57)摘要

本发明提供一种基板及其制备方法、显示面板,涉及显示技术领域,可改善因吸水剂进入OLED器件内部,造成颗粒污染,从而影响OLED器件的使用寿命的问题。所述基板,划分出显示区,所述基板包括衬底,设置在所述衬底上的第一电极和电致发光层,所述第一电极设置在所述电致发光层远离所述衬底一侧;所述基板还包括设置在所述第一电极远离所述衬底一侧的吸水剂阻隔层,所述吸水剂阻隔层位于所述显示区;所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。



1. 一种基板,划分出显示区,所述基板包括衬底,设置在所述衬底上的第一电极和电致发光层,所述第一电极设置在所述电致发光层远离所述衬底一侧;其特征在于,

所述基板还包括设置在所述第一电极远离所述衬底一侧的吸水剂阻隔层,所述吸水剂阻隔层位于所述显示区;

所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。

2. 根据权利要求1所述的基板,其特征在于,所述吸水剂阻隔层覆盖所述显示区。

3. 根据权利要求1所述的基板,其特征在于,所述第一电极覆盖所述显示区,所述吸水剂阻隔层包括1~15层层叠设置的石墨烯层。

4. 根据权利要求3所述的基板,其特征在于,每层所述石墨烯层由多个子膜层连接而成;

其中,在所述吸水剂阻隔层包括多层所述石墨烯层的情况下,相邻两层所述石墨烯层中,所述多个子膜层的两两之间的连接处交错设置。

5. 根据权利要求1所述的基板,其特征在于,还包括设置在所述电致发光层靠近所述衬底一侧的多个第二电极;

所述第一电极为透射电极,所述多个第二电极中的每个为反射电极。

6. 根据权利要求1所述的基板,其特征在于,所述第一电极覆盖所述显示区,所述基板还包括设置在所述第一电极与所述吸水剂阻隔层之间的填平层。

7. 根据权利要求6所述的基板,其特征在于,

所述填平层为透明导电层;

和/或,

所述填平层的厚度为5~10 μm ;

和/或,

所述填平层的材料包括导电聚合物。

8. 一种基板的制备方法,其特征在于,所述基板划分出显示区,所述制备方法包括:

在衬底上形成电致发光层;

在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极;

在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,所述吸水剂阻隔层位于所述显示区;其中,所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。

9. 根据权利要求8所述的基板的制备方法,其特征在于,所述在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,包括:

在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,所述第一电极覆盖所述显示区;

所述在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,包括:通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层贴附在形成有所述第一电极的衬底上,作为所述吸水剂阻隔层;

或者,

所述在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,包括:

在形成有所述第一电极的衬底上形成透明导电填平薄膜;

通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层贴附在所述透明导电填平薄膜上,作为

所述吸水剂阻隔层；

对所述透明导电填平薄膜进行固化,形成填平层。

10. 一种显示面板,其特征在于,包括权利要求1-7任一项所述的基板;
还包括与所述基板压合的盖板,所述盖板上涂布有包括吸水剂的封装胶。

基板及其制备方法、显示面板

技术领域

[0001] 本发明涉及显示技术领域,尤其涉及基板及其制备方法、显示面板。

背景技术

[0002] OLED (Organic Light-Emitting Diode,有机电致发光二极管)显示装置由于具有薄、轻、宽视角、主动发光、发光颜色连续可调、成本低、高色域、高对比度、响应速度快、耗能小、驱动电压低、工作温度范围宽、生产工艺简单、发光效率高及可柔性显示等优点,已被列为具有发展前景的下一代显示技术,但是仍有一些问题亟待解决。

[0003] 由于OLED器件在水汽和氧气的作用下,会出现腐蚀损坏的现象,因此,选择较好的封装方式对OLED器件来说尤为重要。传统工艺中,经常在封装胶中加入吸水剂(或称为干燥剂),来增强封装效果。但是吸水剂一般为氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化钡(BaO)等粉末颗粒化学吸附剂或凝胶物理吸附剂,吸水剂在胶材固化后由于扩散作用会进入OLED器件(包括阴极、阳极、发光功能层等)内部,造成颗粒(Particle)污染,从而影响OLED器件的使用寿命。

发明内容

[0004] 本发明的实施例提供一种基板及其制备方法、显示面板,可改善因吸水剂进入OLED器件内部,造成颗粒污染,从而影响OLED器件的使用寿命的问题。

[0005] 为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

[0006] 一方面,提供一种基板,划分出显示区,所述基板包括衬底,设置在所述衬底上的第一电极和电致发光层,所述第一电极设置在所述电致发光层远离所述衬底一侧;所述基板还包括设置在所述第一电极远离所述衬底一侧的吸水剂阻隔层,所述吸水剂阻隔层位于所述显示区;所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。

[0007] 可选的,所述吸水剂阻隔层覆盖所述显示区。

[0008] 可选的,所述第一电极覆盖所述显示区,所述吸水剂阻隔层包括1~15层层叠设置的石墨烯层。

[0009] 可选的,每层所述石墨烯层由多个子膜层连接而成;其中,在所述吸水剂阻隔层包括多层所述石墨烯层的情况下,相邻两层所述石墨烯层中,所述多个子膜层的两两之间的连接处交错设置。

[0010] 可选的,所述基板还包括设置在所述电致发光层靠近所述衬底一侧的多个第二电极;所述第一电极为透射电极,所述多个第二电极中的每个为反射电极。

[0011] 可选的,所述第一电极覆盖所述显示区,所述基板还包括设置在所述第一电极与所述吸水剂阻隔层之间的填平层。

[0012] 可选的,所述填平层为透明导电层。

[0013] 可选的,所述填平层的厚度为5~10 μm 。

[0014] 可选的,所述填平层的材料包括导电聚合物。

[0015] 第二方面,提供一种基板的制备方法,所述基板划分出显示区,所述制备方法包括:在衬底上形成电致发光层;在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极;在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,所述吸水剂阻隔层位于所述显示区;其中,所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。

[0016] 可选的,所述在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,包括:在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,所述第一电极覆盖所述显示区;所述在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,包括:通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层贴附在形成有所述第一电极的衬底上,作为所述吸水剂阻隔层。

[0017] 可选的,所述在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,包括:在形成有所述电致发光层的衬底上形成第一电极,所述第一电极覆盖所述显示区;所述在形成有所述第一电极的衬底上形成吸水剂阻隔层,包括:在形成有所述第一电极的衬底上形成透明导电填平薄膜;通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层贴附在所述透明导电填平薄膜上,作为所述吸水剂阻隔层;对所述透明导电填平薄膜进行固化,形成填平层。

[0018] 第三方面,提供一种显示面板,包括第一方面任一项所述的基板;还包括与所述基板压合的盖板,所述盖板上涂布有包括吸水剂的封装胶。

[0019] 本发明提供一种基板及其制备方法、显示面板,通过在第一电极远离衬底一侧设置吸水剂阻隔层,这样一来,当将基板应用于显示面板时,位于吸水剂阻隔层远离衬底一侧的吸水剂发生扩散移动至吸水剂阻隔层远离衬底一侧时,在吸水剂阻隔层的阻隔作用下,吸水剂无法穿过吸水剂阻隔层进入到OLED器件内部,从而可改善因吸水剂进入OLED器件内部,造成颗粒污染,从而影响OLED器件的使用寿命的问题。

附图说明

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 图1为本发明实施例提供的一种基板的结构示意图一;

[0022] 图2为本发明实施例提供的一种吸水剂阻隔层的结构示意图;

[0023] 图3为本发明实施例提供的一种基板的结构示意图二;

[0024] 图4为本发明实施例提供的一种显示面板的结构示意图;

[0025] 图5为本发明实施例提供的一种基板的制备方法的流程图。

[0026] 附图标记:

[0027] 01-显示区;10-衬底;20-第一电极;30-电致发光层;40-吸水剂阻隔层;41-石墨烯层;411-子膜层;50-第二电极;60-填平层;70-像素界定层;80-封装胶。

具体实施方式

[0028] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0029] 本发明实施例提供一种基板,如图1所示,划分出显示区01,基板包括衬底10,设置在衬底10上的第一电极20和电致发光层30,第一电极20设置在电致发光层30远离衬底10一侧;基板还包括设置在第一电极20远离衬底10一侧的吸水剂阻隔层40,吸水剂阻隔层40位于显示区01;吸水剂阻隔层40用于阻隔位于吸水剂阻隔层40远离衬底10一侧的吸水剂透过吸水剂阻隔层40。

[0030] 需要说明的是,第一,第一电极20可以为透射电极,也可以为反射电极;可以为阳极,也可以为阴极。

[0031] 第二,电致发光层30包括在电场作用下发三基色光的发光单元,其中,第一基色、第二基色和第三基色可以互为红色、蓝色和绿色,例如,第一基色为红色、第二基色为蓝色、第三基色为绿色,当然也可以是其他组合。或者,第一基色、第二基色和第三基色也可以互为青色、品红和黄色,例如,第一基色为青色、第二基色为品红、第三基色为黄色,当然也可以是其他组合。

[0032] 当然,电致发光层30还可以包括发白光的发光单元。

[0033] 第三,第一电极20和电致发光层30之间可以设置其他发光功能层,本发明并不限定为第一电极20设置在电致发光层30的表面。

[0034] 第四,当基板应用于显示装置时,盖板和基板通过封装胶密封,而相关技术中,为了增强封装效果,封装胶中通常掺加有吸水剂,本发明实施例不对吸水剂阻隔层40具体结构、材料以及阻隔吸水剂的方式进行限定。

[0035] 例如,可以是吸水剂阻隔层40包括具有较强致密性的材料,以阻隔吸水剂穿过吸水剂阻隔层40;还可以是吸水剂阻隔层40包括可吸附吸水剂的材料,以阻隔吸水剂穿过吸水剂阻隔层40;或者是吸水剂阻隔层40包括可与吸水剂发生反应的材料,以阻隔吸水剂穿过吸水剂阻隔层40。

[0036] 第五,吸水剂阻隔层40位于显示区01,例如在一些实施例中,如图1所示,吸水剂阻隔层40覆盖整个显示区01;在一些实施例中,显示区01划分出多个开口区,吸水剂阻隔层40分为多块,每块覆盖一个开口区;当然,还可以是其他分部方式。

[0037] 本发明实施例提供的基板,通过在第一电极20远离衬底10一侧设置吸水剂阻隔层40,这样一来,当将基板应用于显示面板时,位于吸水剂阻隔层40远离衬底10一侧的吸水剂发生扩散移动至吸水剂阻隔层40远离衬底10一侧时,在吸水剂阻隔层40的阻隔作用下,吸水剂无法穿过吸水剂阻隔层40进入到OLED器件内部,从而可改善因吸水剂进入OLED器件内部,造成颗粒污染,从而影响OLED器件的使用寿命的问题。

[0038] 对于顶发射型OLED,作为出光面OLED的顶电极必须具备良好的光透过率。目前,顶发射透明电极使用的多为薄金属、ITO、IZO等材料,其中,金属由于透过率较差,薄化后作为大面积电极使用容易造成电阻增大,不利于大尺寸器件的开发。ITO(Indium Tin Oxide, 铟锡氧化物)、IZO(Indium Zinc Oxide, 铟锌氧化物)等透明度高的材料,其本身的导电性能弱于金属。因此相关技术中,将金属作为辅助电极,采用光刻的方法制作在非发光区域,提高顶发射透明电极的整体导电性,达到降低电阻的作用。但是这种光刻技术需要复杂的工

艺,涉及多道掩膜板和曝光工序,而且由于其需要高温、光刻胶冲刷等工艺特点,会对OLED器件的电致发光层30造成损害,不适合作为量产手段。在封装盖板上制作辅助电极也是现有技术中的一种增加电极导电性的一种方式,使用该种方式可以避免第一种制作工艺中存在的问题。但是,辅助电极依托于封装盖板,导致器件盒厚变大,不利于显示器件的薄化。

[0039] 基于此,在一些实施例中,如图1所示,第一电极20覆盖显示区01,如图2所示,吸水剂阻隔层40包括1~15层层叠设置的石墨烯层41(图2以包括5层层叠设置的石墨烯层41为例)。

[0040] 其中,石墨烯为导电材料,石墨烯层41设置在第一电极20远离衬底10的表面时,或者第一电极20与石墨烯层41之间设置有导电层时,石墨烯层41与第一电极20导通。

[0041] 此外,由于单层石墨烯层41容易破裂,本发明中可使吸水剂阻隔层40包括多层石墨烯层41。

[0042] 此处,一方面,由于石墨烯层41的致密性较强,使得当吸水剂阻隔层40包括石墨烯层41时,可对吸水剂进行有效的阻隔,防止吸水剂接触OLED器件产生损害;另一方面,石墨烯层41具有较好的柔韧性,可适用于柔性显示面板;再一方面,石墨烯层41为导电层,可与第一电极20导通,作为辅助电极,显示面板中无需单独设置辅助电极,并且石墨烯层41的光透过率达到95%左右,不会影响光透过率。

[0043] 为了保证对吸水剂的阻隔效果,在一些实施例中,如图2所示,每层石墨烯层41由多个子膜层411连接而成;其中,在吸水剂阻隔层40包括多层石墨烯层41的情况下,相邻两层石墨烯层41中,多个子膜层411的两两之间的连接处交错设置。

[0044] 此处,由于石墨烯层41为一个面状结构,因此,子膜层411之间的连接方式例如可以是拼接,也可以是搭接,或者是其他连接方式。

[0045] 每一层石墨烯层41包括多个子膜层411,多个子膜层411连接为一个面状结构,多个子膜层411的形状可以相同,也可以不同。例如,每个子膜层411为200mm×200mm的矩形,多个子膜层411连接为一个面状结构。

[0046] 每一层石墨烯层41会有多个由两两子膜层411连接时形成的连接处,位于相邻两层石墨烯层41中的连接处交错设置。

[0047] 在一些实施例中,如图3所示,基板还包括设置在电致发光层30靠近衬底10一侧的多个第二电极50;第一电极20为透射电极,多个第二电极50中的每个为反射电极。

[0048] 基板中还可以包括多个薄膜晶体管,每个薄膜晶体管连接一个第二电极50。当基板应用于显示面板时,显示面板为顶发射型显示面板。

[0049] 为了避免直接在第一电极20表面形成吸水剂阻隔层40时,吸水剂阻隔层40会断裂,在一些实施例中,如图3所示,第一电极20覆盖显示区01,基板还包括设置在第一电极20与吸水剂阻隔层40之间的填平层60。

[0050] 其中,填平层60的材料可以为导电材料,也可以为绝缘材料,填平层60的材料可以为不透明材料,基板适用于底发射型显示面板,填平层60的材料也可以为透明材料,基板适用于底发射型显示面板和顶发射型显示面板。

[0051] 如图3所示,提供一种具体的基板结构,依次在衬底10上形成薄膜晶体管、像素界定层70、第二电极50,发光功能层、第一电极20。像素界定层70的高度一般比较高,导致第一电极20平坦性较差。

[0052] 此处,采用填平层60对开口区位置处进行填充,可以防止在形成吸水剂阻隔层40时,吸水剂阻隔层40断裂。

[0053] 在一些实施例中,填平层60为透明导电层。

[0054] 石墨烯层41为导电层,填平层60为导电层,第一电极20、填平层60、石墨烯层41层叠设置。这样一来,石墨烯层41可与第一电极20导通,作为辅助电极,显示面板中无需单独设置辅助电极,并且石墨烯层41的光透过率达到95%左右,填平层60为透明材料,不会影响光透过率。

[0055] 在一些实施例中,填平层60的材料包括导电聚合物。

[0056] 示例性的,填平层60的材料为无机-有机纳米复合材料,主体材料包括聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚丙烯酸、聚丙烯酸酯、聚酰胺、聚酰亚胺、聚碳酸酯、聚氨酯丙烯酸酯、聚酯、聚硅氧烷、聚硅氮烷等形成的混合物。可掺杂半径为1nm-10nm的量子点、纳米线、纳米棒,具体材料例如为五氟化砷(AsF₅)、六氟锑酸(SbF₆)、氯化铁(FeCl₃)、四氯化锡(SnCl₄)、高氯酸银(AgClO₄)等。还可以掺杂碘(I₂)、溴(Br₂)等添加剂。例如,可以以掺杂材料比总材料的体积比为20%~40%的体积比混在主体聚合物中。

[0057] 在一些实施例中,填平层60的厚度为5~10μm。

[0058] 例如,可以为6μm、7μm、8μm、9μm。

[0059] 本发明实施例还提供一种显示面板,如图4所示,包括上述基板,还包括与基板压合的盖板,盖板上涂布有包括吸水剂的封装胶80。

[0060] 封装胶80的涂布方式可参考相关技术,封装胶80,可以为紫外固化型树脂胶或热固化树脂胶。封装胶80的材料,例如可以包括:环氧树脂、丙烯酸环氧丙酯、甲基丙烯酸环氧丙酯、甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸乙酯、甲基丙烯酸正丁酯、甲基聚丙烯酸6,7-环氧庚酯、甲基丙烯酸-2-羟基乙酯等单体的均聚物或者三聚氰胺甲醛树脂、不饱和聚酯树脂、有机硅树脂、呋喃树脂等共聚物。

[0061] 吸水剂例如可以包括CaO、MgO、BaO等干燥剂颗粒或甘油、二甘醇等液体干燥剂。

[0062] 上述显示面板具体可以是OLED显示器、OLED电视、数码相框、手机、平板电脑、导航仪等具有任何显示功能的产品或者部件。

[0063] 本发明提供的显示面板包括上述基板,有益效果与上述基板相同,此处不再赘述。

[0064] 本发明实施例还提供一种基板的制备方法,如图5所示,包括:

[0065] S10、在衬底10上形成电致发光层30。

[0066] 其中,具体的形成工艺,可参考相关技术。

[0067] S20、在形成有电致发光层30的衬底10上形成第一电极20。

[0068] 在一些实施例中,步骤S20包括:在形成有电致发光层30的衬底10上形成第一电极20,第一电极20覆盖显示区01。

[0069] S30、在形成有第一电极20的衬底10上形成吸水剂阻隔层40,吸水剂阻隔层40位于显示区01;其中,吸水剂阻隔层40用于阻隔位于吸水剂阻隔层40远离衬底10一侧的吸水剂透过吸水剂阻隔层40。

[0070] 在一些实施例中,步骤S30包括:通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层41贴附在形成有第一电极20的衬底10上,作为吸水剂阻隔层40。

[0071] 例如,可以在基底上形成一层石墨烯层41,然后采用机械剥离的方法转印至未固

化的第一电极20上,然后重复上述步骤,形成多层石墨烯层41,通过多次转印工艺形成吸水剂阻隔层40。也可以是在基底上形成1~15层层叠设置的石墨烯层41,然后采用机械剥离的方法转印至第一电极20上,通过一次转印形成吸水剂阻隔层40。

[0072] 在一些实施例中,步骤S30包括:

[0073] S31、在形成有第一电极20的衬底10上形成透明导电填平薄膜。

[0074] 例如,可以通过打印的方式,在第一电极20的上表面形成5~10 μm 的透明导电填平薄膜,形成在开口区内,填充像素内部空间。

[0075] S32、通过转印技术将1~15层层叠设置的石墨烯层41贴附在透明导电填平薄膜上,作为吸水剂阻隔层40。

[0076] 例如,可以在基底上形成一层石墨烯层41,然后采用机械剥离的方法转印至未固化的透明导电填平薄膜上,然后重复上述步骤,形成多层石墨烯层41,通过多次转印工艺形成吸水剂阻隔层40。也可以是在基底上形成1~15层层叠设置的石墨烯层41,然后采用机械剥离的方法转印至未固化的透明导电填平薄膜上,通过一次转印形成吸水剂阻隔层40。

[0077] S33、对透明导电填平薄膜进行固化,形成填平层60。

[0078] 例如,通过紫外线照射对透明导电填平薄膜进行固化,形成填平层60。

[0079] 本发明实施例提供的基板的制备方法的有益效果与基板的有益效果相同,此处不再赘述。

[0080] 示例一种具体的显示面板的制备方法,在衬底10上依次形成薄膜晶体管、阵列排布的阳极、1.5 μm 高的像素界定层70、发光功能层、面状阴极等结构。

[0081] 然后在面状阴极表面将掺杂40%FeCl₃·I₂的聚苯乙烯、聚丙烯混合物通过打印的方式形成10 μm 厚的透明导电填平薄膜,填充开口区内部空间。

[0082] 再通过转印的方式,将单层石墨烯层41贴覆在透明导电填平薄膜上,照射紫外光使透明导电填平薄膜固化,形成填平层60。

[0083] 在盖板上涂布带有吸水剂的封装胶,将盖板与基板压合,固化封装胶,完成封装结构。

[0084] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

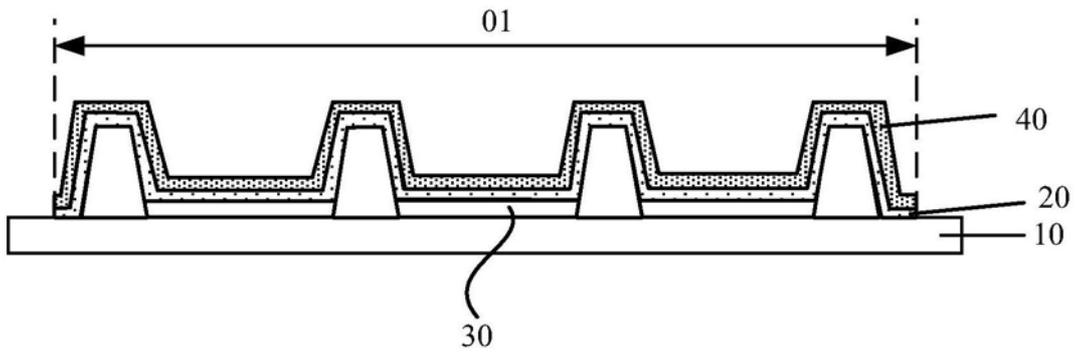


图1

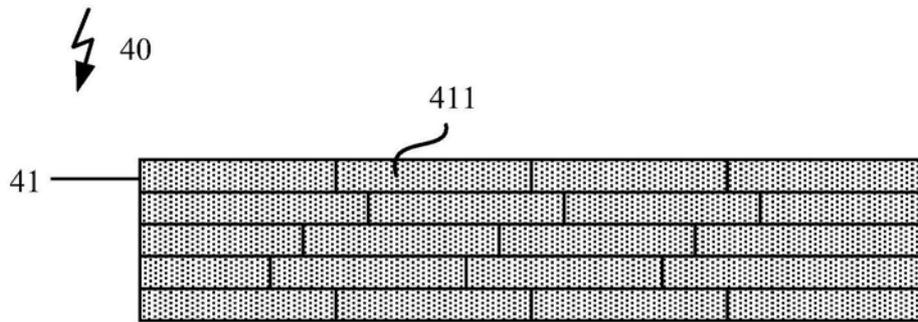


图2

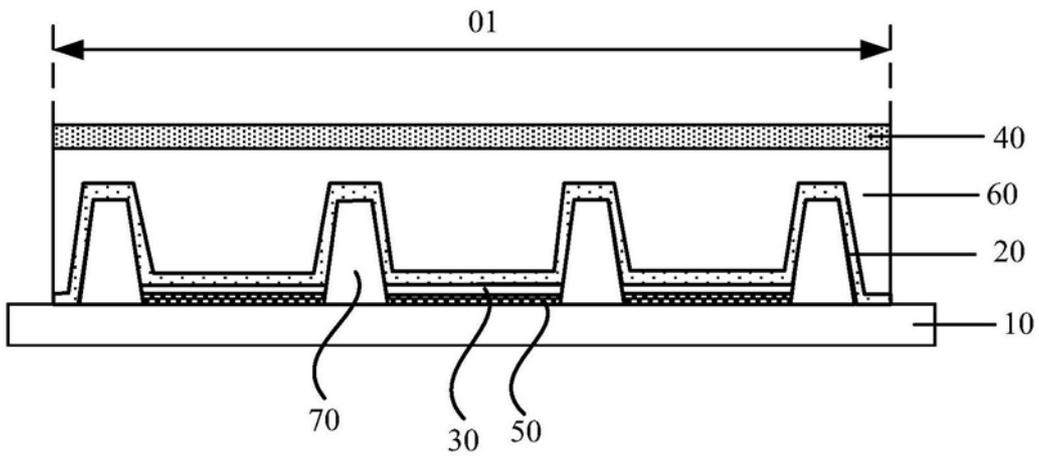


图3

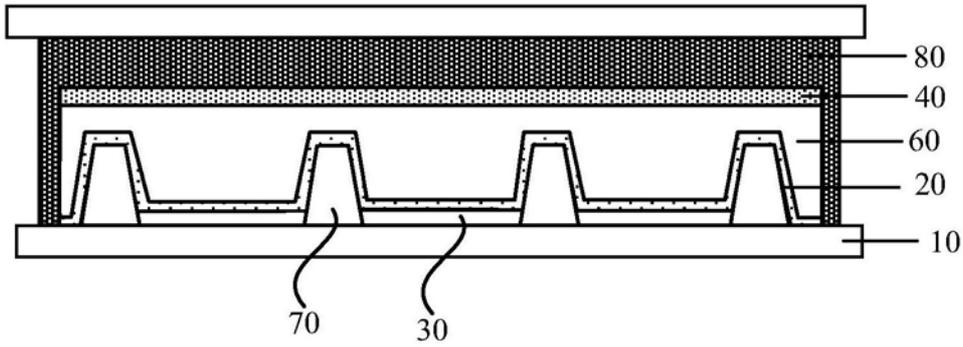


图4

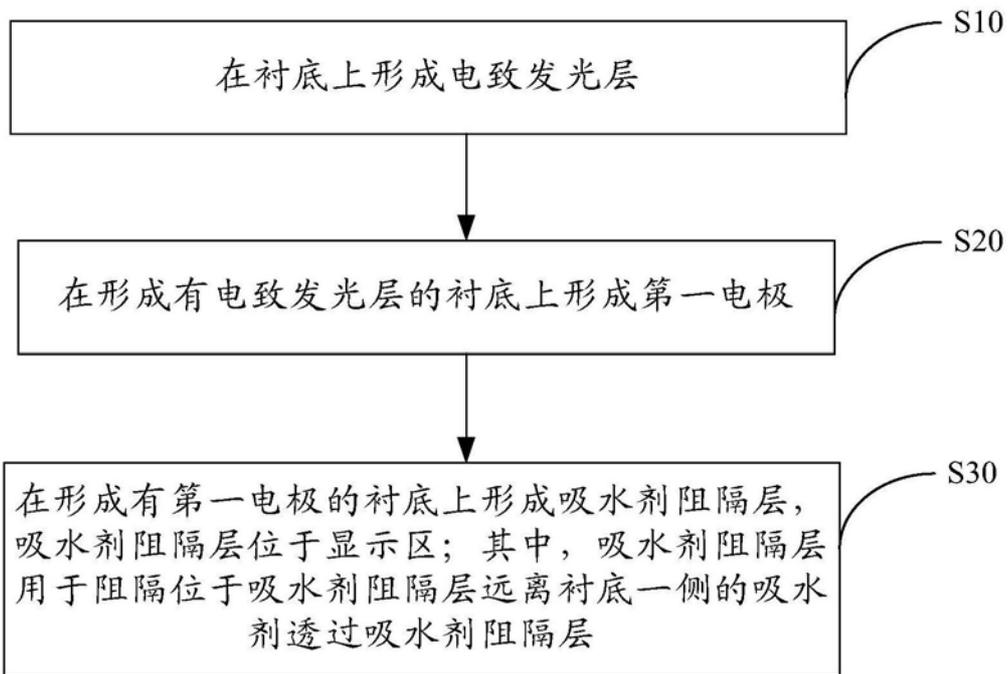


图5

专利名称(译)	基板及其制备方法、显示面板		
公开(公告)号	CN109494311A	公开(公告)日	2019-03-19
申请号	CN201811367369.0	申请日	2018-11-16
[标]申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
当前申请(专利权)人(译)	京东方科技集团股份有限公司		
[标]发明人	罗程远		
发明人	罗程远		
IPC分类号	H01L51/52 H01L51/56 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/32 H01L51/5237 H01L51/56		
外部链接	Espacenet SIPO		

摘要(译)

本发明提供一种基板及其制备方法、显示面板，涉及显示技术领域，可改善因吸水剂进入OLED器件内部，造成颗粒污染，从而影响OLED器件的使用寿命的问题。所述基板，划分出显示区，所述基板包括衬底，设置在所述衬底上的第一电极和电致发光层，所述第一电极设置在所述电致发光层远离所述衬底一侧；所述基板还包括设置在所述第一电极远离所述衬底一侧的吸水剂阻隔层，所述吸水剂阻隔层位于所述显示区；所述吸水剂阻隔层用于阻隔位于所述吸水剂阻隔层远离所述衬底一侧的吸水剂透过所述吸水剂阻隔层。

